

Laser-Lithographiesystem für Prototypen

Zusammenfassung

Gefördert wird die Einrichtung des Lithographie-Zentrums Wien. Das Laser-Lithographiesystem ermöglicht ein wesentlich schnelleres Verfahren zur Herstellung von dreidimensional gemusterten Oberflächen von Prototypen, dabei wird eine strahlungsempfindliche Schicht punktweise mittels eines Belichtungsstrahles bestrahlt, bereichsweise entfernt oder abgetragen. Eingesetzt wird dieses Verfahren sowohl im Bereich Grundlagenforschung, im Bereich der Materialwissenschaften aber auch bei der Herstellung von Atomchips sowie im Bereich des Maschinenbaus. Insgesamt werden 520.120 Euro investiert, wobei 288.449 Euro vom UIP kommen.

Principal Investigator:

Institution: Vienna University of Technology

Status: Abgeschlossen (-) 0 Monate

Fördersumme: EUR 288.449

Weiterführende Links zu den beteiligten Personen und zum Projekt finden Sie unter

https://archiv.wwtf.at/programmes/university_infrastructure/UIP07-TU